特別管理産業廃棄物排出源別一覧表（汚泥、廃酸、廃アルカリ）

物質名		アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チラウム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4-ジオキサン	DXN
基準値[4]	汚泥の場合[1]	N.D.[3]	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3
	廃酸、廃アルカリの場合[1]	N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
	処理物[2] 廃酸、廃アルカリの場合	N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
	処理物[2] 廃酸、廃アルカリ以外の場合	N.D.	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3

排出源 業種	施設	アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チラウム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4-ジオキサン	DXN
		適用																									
19.紡績業又は繊維製品製造業若しくは加工業	ト 染色施設						○				○	○				○	○	○									
	チ 薬液浸透施設										○	○				○	○	○									
	リ のり抜き施設															○		○									
21.化学繊維製造業	イ 湿式紡糸施設												○														
	ロ リンター又は未精錬繊維の薬液処理施設												○														
	ハ 原料回収施設												○			○								○		○	
22.木材薬品処理業	ロ 薬液浸透施設						○	○																			
23.パルプ、紙又は紙加工品の製造業	イ 原料浸せき施設									○																	
	ニ 蒸解施設									○																	
	ホ 蒸解廃液濃縮施設									○																	
	ヘ チップ及びパルプ洗浄施設									○																	
	ト 漂白施設									○																	
	チ 抄紙施設									○																	
	リ セロハン製膜施設																							○			
	ヌ 湿式繊維板成型施設									○																	
	ル 廃ガス洗浄施設									○														○			
23の2.新聞業、出版業、印刷業又は製版業	現像洗浄施設等										○	○	○			○	○	○									
24.化学肥料製造業	イ ろ過施設							○																			
	ロ 分離施設							○																			
	ハ 水洗式破砕施設							○																			
	ニ 廃ガス洗浄施設							○																			
	ホ 湿式集じん施設							○																			
25.水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリ製造業	イ 塩水精製施設	○	○																								
	ロ 電解施設	○	○																								
26.無機顔料製造業	イ 洗浄施設	○	○	○	○		○		○																○		
	ロ ろ過施設	○	○	○	○		○		○																○		
	ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち遠心分離機			○																					○		
	ホ 廃ガス洗浄施設	○	○	○	○		○		○																○		
27.前2号以外の無機化学工業製品製造業	イ ろ過施設	○	○	○	○		○	○	○																○		
	ロ 遠心分離機	○	○	○	○		○	○	○																○		
	ヘ 青酸反応施設のうち反応施設								○																		
	ヌ 廃ガス洗浄施設	○	○	○	○		○	○	○																○		
	ル 湿式集じん施設	○	○	○	○		○	○																	○		
28.カーバイト法アセチレン誘導品製造業	イ 湿式アセチレンガス発生施設								○																		
	ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設	○	○												○												
29.コールタール製品製造業	イ ベンゼン類硫酸洗浄施設																							○			
	ロ 静置分離器																							○			

物質名			アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2－ジクロロエタン	1,1－ジクロロエチレン	シス1,2－ジクロロエチレン	1,1,1－トリクロロエタン	1,1,2－トリクロロエタン	1,3－ジクロロプロペン	チラウム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4－ジオキサン	DXN
基準値[4]	汚泥の場合[1]		ND[3]	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3
	廃酸、廃アルカリの場合[1]		N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
	処理物[2]	廃酸、廃アルカリの場合	N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
		廃酸、廃アルカリ以外の場合	N.D.	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3

排出源 業種	施設	アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2－ジクロロエタン	1,1－ジクロロエチレン	シス1,2－ジクロロエチレン	1,1,1－トリクロロエタン	1,1,2－トリクロロエタン	1,3－ジクロロプロペン	チラウム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4－ジオキサン	DXN
31.メタン誘導品製造業	イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち蒸留施設												○	○													
	ハ フロンガス製造施設のうち洗浄施設及びろ過施設										○	○		○		○	○	○									
32.有機顔料又は合成染料製造業	イ ろ過施設						○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○			
	ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち水洗施設						○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○			
	ハ 遠心分離機						○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○			
	ニ 廃ガス洗浄施設						○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○			
33.合成樹脂製造業	イ 縮合反応施設																									○	
	ロ 水洗施設								○				○	○	○	○	○		○					○		○	
	ハ 遠心分離機								○				○	○	○	○	○		○					○		○	
	ニ 静置分離器												○	○	○	○	○		○					○		○	
	ホ フッ素樹脂製造施設のうちガス冷却洗浄施設及び蒸留施設										○	○		○		○	○	○									
	リ 廃ガス洗浄施設								○				○	○	○	○	○		○					○		○	
	ヌ 湿式集じん施設												○	○	○	○	○		○					○		○	
34.合成ゴム製造業	イ ろ過施設											○	○	○		○	○				○			○			
	ロ 脱水施設											○	○	○		○	○				○			○			
	ハ 水洗施設								○			○	○	○		○	○				○			○			
	ニ ラテックス濃縮施設								○			○	○	○		○	○				○			○			
	ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち静置分離器								○					○							○			○			
	チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち蒸留施設及び濃縮施設																										
35.有機ゴム薬品製造業	イ 蒸留施設																				○						
	ロ 分離施設																				○						
	ハ 廃ガス洗浄施設																				○						
37.前6号以外の石油化学工業	イ 洗浄施設										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○	
	ロ 分離施設										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○	
	ハ ろ過施設										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○	
	ニ アクリロニトリル製造施設のうち急冷施設及び蒸留施設								○																		
	ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミン製造施設のうち蒸留施設			○																				○			
	ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設																							○			
	ト イソプロピルアルコール製造施設のうち蒸留施設及び硫酸濃縮施設																							○			

物質名		アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チラウム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4-ジオキサン	DXN
基準値[4]	汚泥の場合[1]	ND[3]	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3
	廃酸、廃アルカリの場合[1]	N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
	処理物[2] 廃酸、廃アルカリの場合	N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
	処理物[2] 廃酸、廃アルカリ以外の場合	N.D.	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3

排出源 業種	施設	適用																									
37.前6号以外の石油化学工業	チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち蒸留施設及び濃縮施設																									○	
	ヌ シクロヘキサンノン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設																							○			
	ヲ ノルマルパラフィン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設								○															○			
	ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち反応施設及びメチルアルコール回収施設																										
	タ 廃ガス洗浄施設			○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○	
38の2.界面活性剤製造業	反応施設																									○	
41.香料製造業	イ 洗浄施設												○	○										○			
	ロ 抽出施設										○	○	○	○		○	○							○			
43.写真感光材料製造業	感光剤洗浄施設			○																							
46.第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業	イ 水洗施設	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ロ ろ過施設	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ニ 廃ガス洗浄施設	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
47.医薬品製造業	ロ ろ過施設	○	○		○		○	○	○				○	○	○			○						○		○	
	ハ 分離施設	○	○		○		○	○	○				○	○	○			○						○		○	
	ニ 混合施設	○	○		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○						○		○	
	ホ 廃ガス洗浄施設	○	○		○		○	○	○				○	○	○			○						○		○	
49.農薬製造業	混合施設				○	○		○												○	○	○	○				
50.第2条各号に掲げる物質を含有する試薬製造業	試薬製造施設	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
51.石油精製業	イ 脱塩施設																							○			
	ロ 原油常圧蒸留施設																							○			
	ハ 脱硫施設																							○			
	ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設																							○			
	ホ 潤滑油洗浄施設										○					○	○	○						○			
51の2.自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブ製造業、ゴムホース製造業工業用ゴム製品製造業、更正タイヤ製造業又はゴム板製造業	直接加硫施設																				○						

物質名			アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チラウム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4-ジオキサン	DXN
基準値[4]	汚泥の場合[1]		ND[3]	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3
	廃酸、廃アルカリの場合[1]		N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
	処理物[2]	廃酸、廃アルカリの場合	N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
		廃酸、廃アルカリ以外の場合	N.D.	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3

排出源 業種	施設	アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チラウム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4-ジオキサン	DXN
		適用																									
53.ガラス又はガラス製品製造業	イ 研磨洗浄施設			○	○			○					○			○		○							○		
	ロ 廃ガス洗浄施設			○	○			○																	○		
58.窯業原料精製業	イ 水洗式破砕施設			○	○																				○		
	ロ 水洗式分別施設			○	○																				○		
	ハ 酸処理施設			○	○																				○		
	ニ 脱水施設			○	○																				○		
61.鉄鋼業	イ タール及びガス液分離施設								○															○			
	ロ ガス冷却洗浄施設																							○			
62.非鉄金属製造業	イ 還元そう							○																	○		
	ロ 電解施設				○			○																	○		
	ニ 水銀精製施設	○	○																								
	ホ 廃ガス洗浄施設	○	○	○	○			○																	○		
	ヘ 湿式集じん施設	○	○	○	○			○																	○		
63.金属製品製造業又は機械器具製造業	イ 焼入れ施設								○																		
	ロ 電解式洗浄施設						○		○																		
	ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設			○	○																						
	ニ 水銀精製施設	○	○																								
	ホ 廃ガス洗浄施設	○	○	○	○		○																		○		
64.ガス供給業又はコークス製造業	イ タール及びガス液分離施設								○															○			
	ロ ガス冷却洗浄施設								○															○			
65.酸又はアルカリによる表面処理施設				○	○		○	○																	○		
66.電気めっき施設				○	○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○									
66の2.エチレンオキサイド又は1.4-ジオキサンの混合施設																										○	
66の3.旅館業	ハ 入浴施設							○																			
67.洗濯業	洗浄施設										○	○		○	○	○	○	○									
68.写真現像業	現像洗浄施設			○					○																		
71の2.化学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設	イ 洗浄施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ロ 焼入れ施設								○																		
71の5.トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設											○	○	○														
71の6.トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる蒸留施設													○														
写真感光材料製造業	溶解施設												○														
石油精製業	改質施設															○		○									
トリニトロレゾルシン鉛製造施設					○																						
青化法精製施設									○																		
石油製品製造業	蒸留施設										○	○		○	○	○	○	○	○	○				○			

物質名			アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チラウム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4-ジオキサン	DXN
基準値[4]	汚泥の場合[1]		ND[3]	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3
	廃酸、廃アルカリの場合[1]		N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
	処理物[2]	廃酸、廃アルカリの場合	N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.2	0.4	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
		廃酸、廃アルカリ以外の場合	N.D.	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.02	0.04	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3

排出源		適用																										
業種	施設																											
廃油	イ　蒸留施設										○	○		○	○	○	○	○	○	○				○		○	
アセチレン精製施設		○	○																									
その物質による表面処理施設											○	○	○	○	○			○						○		○	
トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設																	○										
含有塗料の塗装施設																										○	
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は1,1,1-トリクロロエタンによる表面処理施設																○											
指定下水汚泥		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
※1　硫酸パルプ又は亜硫酸パルプ製造の塩素又は塩素化合物漂白施設																												○
※2　カーバイト法アセチレン製造のアセチレン洗浄施設																												○
※3　硫酸カリウム製造施設のうち廃ガス洗浄施設																												○
※4　アルミナ繊維製造施設のうち廃ガス洗浄施設																												○
※5　塩化ビニルモノマー製造二塩化エチレン洗浄施設																												○
※6　カプロラクタム製造施設のうち硫酸濃縮施設、シンクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設																												○
※7　クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造施設のうち水洗浄施設、廃ガス洗浄施設																												○
※8　4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造施設のうちろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設																												○
※9　2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造施設のうちろ過施設、廃ガス洗浄施設																												○
※10 ジオキサジンバイオレット製造施設のうちニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設																												○
※11 アルミニウム又はその合金製造焙焼炉等の発生ガス処理施設のうち廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																												○
※12 亜鉛回収施設のうち精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																												○
※13 廃棄物焼却炉(火床面積が 0.5 ㎡以上又は焼却能力が 50 kg/h 以上のもの)の発生ガス処理施設のうち廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの																												○

物質名			アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機P	Cr(VI)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2－ジクロロエタン	1,1－ジクロロエチレン	シス1,2－ジクロロエチレン	1,1,1－トリクロロエタン	1,1,2－トリクロロエタン	1,3－ジクロロプロペン	チラウム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4－ジオキサン	DXN
基準値[4]	汚泥の場合[1]		ND[3]	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.04	0.02	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3
	廃酸、廃アルカリの場合[1]		N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.4	0.2	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
	処理物[2]	廃酸、廃アルカリの場合	N.D.	0.05	1	1	1	5	1	1	0.03	3	1	2	0.4	0.2	10	4	30	0.6	0.2	0.6	0.3	2	1	1	5	0.1
		廃酸、廃アルカリ以外の場合	N.D.	0.005	0.3	0.3	1	1.5	0.3	1	0.003	0.3	0.1	0.2	0.04	0.02	1	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1	0.3	0.5	3

排出源 業種	排出源 施設	適用																									
※14 廃PCB等又はPCB処理物分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物洗浄施設又は分離施設																											○
※15 担体付き触媒の製造(塩素又は塩化水素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設																											○
※16 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)から金属の回収(ソーダ灰を添加してばい焼炉で処理する方法及びアルカリによる抽出する方法(ばい焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち次に掲げるもの ・ろ過施設 ・精製施設 ・廃ガス洗浄施設																											○
※17 フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法に限る。＊1)の用に供する施設のうち次に掲げるもの ・プラズマ反応施設 ・廃ガス洗浄施設 ・湿式集じん施設 (＊1　廃棄物混焼法、液中燃焼法、過熱蒸気反応法)																										○

1)　国内で生じたものであって、表中の排出源の工場又は事業場から生じたもの

2)　1）を処分するために処理したもの

3)　環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

4)　基準値ｍｇ/L(溶出量)、ただし「廃酸、廃アルカリ」、「処理物の廃酸、廃アルカリ」はｍｇ/L(含有量)及びDXNの「汚泥、その処理物」はｎｇ－TEQ/g(含有量)

(注)　業種番号と施設記号は水質汚濁防止法施行令別表第1による。

※印の業種番号と施設番号はダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2による。

基準値は、総理府令第5号(ダイオキシン類は環境省令)、廃棄物処理法施行規則別表1(廃酸・廃アルカリ)による。